

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第2区分

【発行日】平成20年2月28日(2008.2.28)

【公表番号】特表2003-526690(P2003-526690A)

【公表日】平成15年9月9日(2003.9.9)

【出願番号】特願2001-566800(P2001-566800)

【国際特許分類】

C 07 B	63/00	(2006.01)
B 01 D	11/04	(2006.01)
B 01 J	31/40	(2006.01)
B 01 J	38/00	(2006.01)
C 07 C	45/50	(2006.01)
C 07 C	47/19	(2006.01)
C 07 B	61/00	(2006.01)

【F I】

C 07 B	63/00	B
B 01 D	11/04	C
B 01 J	31/40	Z
B 01 J	38/00	3 0 1 P
C 07 C	45/50	
C 07 C	47/19	
C 07 B	61/00	3 0 0

【手続補正書】

【提出日】平成20年1月8日(2008.1.8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0085

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0085】

本発明の方法において用いられ得る許容反応条件は、無論、所望される特定合成に依存して選ばれる。かかるプロセス条件は、当該技術において周知である。本発明の方法のすべてが、当該技術において知られた慣用手法に従って行われ得る。本発明の方法を行うための例示的反応条件は、たとえば、Kirk - Othmer, Encyclopedia of Chemical Technology, 第4版, 1996に記載されており、しかしてその関連部分は参照することにより本明細書に合体される。特定の方法に依存して、操作温度は約-80 またはそれ以下から約500 またはそれ以上の範囲にあり得、そして操作圧力は約6895 Pa (1 psig) またはそれ以下から約68.95 MPa (10,000 psig) またはそれ以上の範囲にあり得る。